

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
07.06.2000 Patentblatt 2000/23

(51) Int. Cl.⁷: **G02B 13/24**

(21) Anmeldenummer: **99121205.1**

(22) Anmeldetag: **23.10.1999**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
 Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

• **Carl-Zeiss-Stiftung trading as Carl Zeiss**
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)
 Benannte Vertragsstaaten:
GB

(30) Priorität: **30.11.1998 DE 19855108**

(71) Anmelder:
 • **Carl Zeiss**
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)
 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR NL

(72) Erfinder:
 • **Schuster, Karl-Heinz**
89551 Königsbronn (DE)
 • **Beierl, Helmut**
89522 Heidenheim (DE)

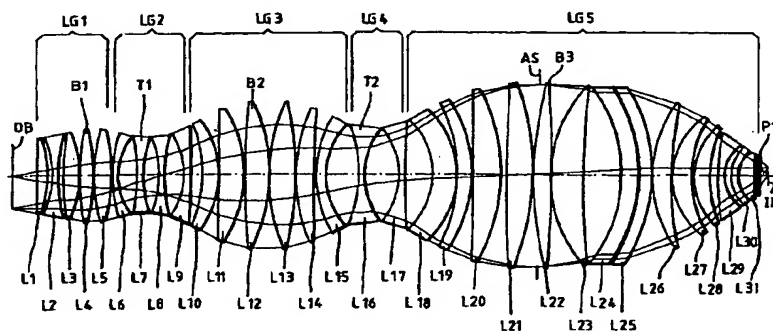
(54) **Mikrolithographisches Reduktionsobjektiv, Projektionsbelichtungsanlage und -Verfahren**

(57) Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenanordnung, bestehend aus

einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft,
 zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft,
 dritten Linsengruppe (LG3) negativer Brechkraft,
 vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft und
 fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft
 wobei
 die Systemblende (AS) in der fünften Linsengruppe

(LG5) liegt und mindestens zwei Linsen dieser Linsengruppe (LG5) vor der Systemblende (AS) liegen. Dabei ist vorgesehen, daß die bildseitige numerische Apertur größer als 0,65 ist (in Beispielen bis 0,8), oder daß diese Linsengruppe (LG5) mindestens 13 Linsen (L18 - L31) aufweist, oder daß die Systemblende (AS) im Bereich der Linse (L22), an der das Lichtbündel den größten Durchmesser annimmt, und ihrer beiden benachbarten Linsen (L21, L23) angeordnet ist.

FIG. 1



Beschreibung

[0001] Das gattungsgemäße mikrolithographische Reduktionsobjektiv nach dem Oberbegriff des Anspruch 1 ist ein rein refraktives Hochleistungsobjektiv, wie es für die hochauflösende Mikrolithographie besonders im DUV-Wellenlängenbereich benötigt wird.

[0002] Derartige refraktive Objektive mit zwei Strahltaillen sind schon in dem Artikel von E. Glatzel „New lenses for microlithography“ SPIE, Vol. 237, 310 (1980) beschrieben und seitdem ständig weiterentwickelt worden. Gattungsgemäße Objektive der Firma Carl Zeiss werden in Wafer-Steppern und Wafer-Scannern PAS der Firma ASML, Niederlande, verkauft.

[0003] Ein derartiges Objektiv der Firma Tropel aus dem Jahre 1991 ist in Figur 16 von J.H. Bruning „Optical Lithography - Thirty years and three orders of magnitude“ SPIE, Vol 3049, 14-27 (1997) gezeigt. Zahlreiche Varianten gattungsgemäßer Projektionsobjektive finden sich in Patentanmeldungen, so EP 0 712 019-A (US Ser. 337 647 v. 10. Nov. 1994), EP 0 717 299-A, EP 0 721 150-A, EP 0 732 605-A, EP 0 770 895-A, EP 0 803 755-A (US 5,781,278), EP 0 828 172-A.

[0004] Ähnliche Objektive mit noch etwas kleinerer numerischer Apertur finden sich auch in SU 1 659 955-A, EP 0 742 492-A (Fig. 3) US 5,105,075 (Fig. 2 und 4), US 5,260,832 (Fig. 9) und DD 299 017-A.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Objektivtyp anzugeben, der im Umfeld des bekannten Stands der Technik durch hohe Auflösung bei großem Bildfeld und kleiner Baulänge hervorragt und dessen Bildfehlerkorrektur, besonders hinsichtlich der Verzeichnung, auch mit verschiedenen Beleuchtungsarten (verschiedener Kohärenzgrad usw.) und bei deutlichem Abblenden (für Belichtungen mit größerem Schärfentiefebereich) stabil bleibt.

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einem Objektiv nach einem der Ansprüche 1, 2 und 11.

[0007] Die Blende wird in die fünfte Linsengruppe im Bereich des dritten Bauchs des Lichtbündels verlegt. Insgesamt erhält diese fünfte Linsengruppe und die Einbindung der Systemblende mehr Bedeutung. Die beim Stand der Technik teilweise der Ausbildung der Taillen, speziell der ersten, gewidmete Aufmerksamkeit wird dann weitgehend bedeutungslos, wie die Ausführungsbeispiele zeigen.

[0008] Die hohe numerische Apertur als primäres Mittel zur Erzielung hoher Auflösung strapaziert das Design im wesentlichen zwischen Systemblende und Bildebene, besonders wenn Baulänge und Linsendurchmesser einigermaßen klein bleiben sollen, was insbesondere für eine leichte Integration in vorhandene Konzepte von Projektionsbelichtungsanlagen und für die Fertigung, sowie auch aus Kostengründen stark bevorzugt wird.

[0009] Demgemäß geben die Unteransprüche 3 bis 9 und 12 vorteilhafte Ausführungsformen der fünften Linsengruppe an.

[0010] Unteranspruch 10 betrifft die besonders vorteilhafte Abblendbarkeit des Objektivs, die durch jeweils einzelne Minimierung der verschiedenen Bildfehler erreicht wird. Dies wird wiederum mit dem Designkonzept der Erfindung ermöglicht. Anders als bei einem Objektiv mit fester Apertur können nicht verschiedene große Fehler subtraktiv ausgemittelt werden. Der Vorteil ist, daß der Anwender das trade-off von Auflösung und Schärfentiefe jeweils bezogen auf den Anwendungsfall optimieren kann.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche 13 bis 16. Eine Projektionsbelichtungsanlage nach den Ansprüchen 17 oder 18 ergibt die optimale Anwendung dieser Objektive und zeichnet sich durch große Anwendungsbreite aus. Besondere Bedeutung hat die nach Anspruch 18 erreichte große Toleranz der Abbildungsleistung gegen Änderungen des Beleuchtungssettings.

[0012] Das Herstellverfahren nach Anspruch 19 macht von der hervorragenden Korrektur des Objektivs durch flexible Beleuchtungs- und Apertureinstellung bei verschiedenen im Herstellprozess aufeinanderfolgenden Belichtungen Gebrauch. Die einzelnen Belichtungen können dabei auf einer Projektionsbelichtungsanlage mit verschiedenen Masken erfolgen, oder es können mehrere erfindungsgemäße Projektionsbelichtungsanlagen - auch in Kombination mit anderen - in einer Fertigungslinie genutzt werden.

[0013] Näher erläutert wird die Erfindung anhand der Zeichnung.

[0014] Dabei zeigen:

Figur 1 den Linsenschnitt eines ersten Ausführungsbeispiels;

Figur 2 den Linsenschnitt eines zweiten Ausführungsbeispiels;

Figur 3 den Linsenschnitt eines dritten Ausführungsbeispiels;

Figur 4a-c die Queraberrationen im Sagittalschnitt für verschiedene Bildhöhen zu Figur 1;

Figur 5a-c die Queraberrationen im Meridionalschnitt für verschiedene Bildhöhen zu Figur 1;

Figur 6 den Linsenschnitt eines vierten Ausführungsbeispiels; und

Figur 7 schematisch ein Beispiel einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage.

5 [0015] Entsprechend dem primären Bedarf für ein erfindungsgemäßes Projektionsobjektiv sind die Beispiele der Figuren 1 bis 3 und 6 für den Betrieb mit einem in der DUV-Mikrolithographie üblichen Excimer-Laser von 248,38 nm Wellenlänge ausgelegt und enthalten ausschließlich Quarzglas-Linsen. Ihre Schnittweite liegt mit 1000 mm für Figuren 2, 3 und 6 bis 1150 mm bei Figur 1 am unteren Ende des Gebräuchlichen und des Machbaren. Die numerische Apertur von 0,70 (bei den Figuren 2, 3 und 6) und 0,80 bei Figur 1 liegt deutlich über dem vorbekannten, zeigt die Potenz des
10 erfindungsgemäßen Designs und erlaubt die Ausführung der Mikrolithographie mit Auflösungen bis herunter zu 0,18 µm und weniger unter Serien-Produktionsbedingungen. Solche Auflösungen galten noch vor kurzem als überhaupt nicht mit der optischen Lithographie zugänglich.

[0016] Mit einer Bildhöhe $2Y_B = 27,2$ mm ergibt sich so bei $NA = 0,70$ der sehr hohe Lichtleitwert von $LLW = NA \cdot 2Y_B = 19,04$. Das Objektiv ist damit für einen Scanner mit einem 8×26 mm² Bildfeld geeignet.

15 [0017] Beachtlich ist dabei, daß die Steigerung der bildseitigen numerischen Apertur von 0,63 schon zu dem erreichten Wert von 0,70 (Fig. 2, 3, 6) wesentlich schwieriger ist als etwa die Steigerung von 0,45 zu 0,6, da bekanntlich bei $NA = 1,0$ in Luft alle Bildfehler einen Pol erreichen und entsprechend bei Annäherung an diesen Wert immer stärker ansteigen bzw. immer schwerer zu korrigieren sind. Das Beispiel der Figur 1 zeigt also mit $NA = 0,8$ eine hervorragende Konstruktion.

20 [0018] Die Linsendaten des Ausführungsbeispiels nach Figur 1 sind in Tabelle 1 angegeben. 31 Linsen L1 bis L31 und eine Planplatte P1 sind vorgesehen. P1 dient als leicht tauschbares waferseitiges Abschlußfenster.

[0019] Der erreichte RMS-Fehler von unter 13 mλ über alle Bildhöhen zeigt eine hervorragende Abbildungsleistung.

25 [0020] Die Linsen L1 bis L5 bilden die erste Linsengruppe LG1 mit dem ersten Bauch B1 des Lichtbündels an der Rückfläche der Linse L4. Eine negative Linse L2 leistet die erforderliche Strahlaufweitung.

[0021] Die Linsengruppe LG2 aus den negativen Linsen L6 bis L9 bildet an der Rückfläche der Linse L7 die erste Taille T1. Typisch für diese Linsengruppe LG2 sind die zur Taille konkaven Menisken L6 und L9.

30 [0022] Die dritte Linsengruppe LG3 besteht aus den fünf positiven Linsen L10 bis L14, deren äußere L10 und L14 jeweils als außenseitig konkave Menisken ausgebildet sind, sowie dem negativen bildseitig konkaven Meniskus L15. An der Rückfläche der Linse L12 ist der zweite Bauch B2 mit dem örtlich maximalen Lichtbündeldurchmesser ausgebildet.

[0023] Die vierte Linsengruppe LG4 besteht aus zwei Negativlinsen L16 und L17. An der Rückfläche der Linse L16 ist die zweite Taille T2 ausgebildet. Hier ist eine starke bikonvexe Luftlinse ausgebildet.

35 [0024] Die fünfte Linsengruppe LG5 mit den 14 Linsen L18 bis L31 ist für das erfindungsgemäße Objektiv am bedeutendsten.

[0025] Vor der Linse L22 ist die Systemblende AS angeordnet. An der Vorderfläche der folgenden Linse L22 ist der dritte Bauch B3 mit seinem gegenüber dem Blendendurchmesser (306,3 mm) nur geringfügig größeren Lichtbündeldurchmesser (308,0 mm) ausgebildet.

40 [0026] Erfindungsgemäß erfolgt die Strahlumlenkung im Bereich des Bauchs B3 durch eine Mehrzahl beidseits der Blende AS angeordneter mäßig stärker und damit ziemlich dünner Positivlinsen L19 bis L23. Damit wird die sphärische Unterkorrektur in diesem Bereich minimiert und gleichzeitig die Baulänge gegenüber dem Einsatz weniger, aber starker und dicker Linsen verringert.

45 [0027] Auch die Variation der Bildfehler beim Abblenden oder bei verschiedenen Beleuchtungs-Einstellungen wird durch diese Maßnahme verringert. Bei den beiden im divergenten Strahlengang stehenden Linsen L19 und L20 erhält letztere mehr Brechkraft. Die Linsen L21 und L22 zeigen gleichmäßig verteilte Brechkraft, der Strahlengang zwischen den beiden ist nahezu parallel. Die Linsen L21 bis L23 übernehmen einen erheblichen Teil der Systembrechkraft bei kleinstmöglicher Erzeugung von sphärischer Überkorrektur und entspannen die Problematik der Abhängigkeit der Fehlerkorrektur von numerischer Apertur und Beleuchtungsart (NA-Sigma-Problem). Somit sind hervorragende Abbildungseigenschaften bei den verschiedensten Beleuchtungseinstellungen und Apertureinstellungen erreichbar.

50 [0028] Die erste Linse L18 der fünften Linsengruppe LG5 ist ein schwach brechender dicker objektseitig konkaver Meniskus. Hier wäre eine Aufteilung durch eine sphärisch überkorrigierende Luftlinse zwar entspannend für die Korrekturwirkung der folgenden Linsen, würde aber die Baulänge unvorteilhaft vergrößern.

55 [0029] Die Linse L24 bildet mit der nur durch einen dünnen Luftspalt getrennten folgenden bikonvexen Linse L25 im wesentlichen einen schwach brechenden dicken Meniskus. Er balanciert durch sphärische Überkorrektur die entsprechende Wirkung der vorangehenden Linsen L18 bis L23. Die Aufspaltung in die zwei Teile L24 und L25 bringt hier wiederum die kürzeste Baulänge. Beide sind die einzigen Linsen bildseitig der Systemblende AS, die objektseitig konkav sind.

[0030] Der genau umgekehrte Vorzug von dicker Linse L18 und aufgespaltenem Meniskus L24, L25 erklärt sich

aus den unterschiedlichen Umgebungen und Arbeitsbereichen der Menisken. L18 steht wenig belastet im divergenten Strahlengang. Alle Strahlen durchlaufen die Linsenflächen weitgehend normal. Der Meniskus L18 wirkt in erster Linie als Petzval-Element und drückt die Petzvalsumme des Objektivs. Diese Funktion kann jedoch auch umverteilt werden, so daß die Dicke reduziert sein kann.

5 [0031] Der aufgesplattene Meniskus L24, L25 steht im Gegensatz dazu im konvergenten Strahlengang und ist mittel bis stark belastet. Er übernimmt allein die Aufgabe der sphärischen Überkorrektur der näheren Umgebung. Bei einteiliger Ausführung bedingt dies eine beachtliche Dicke. Die Aufspaltung des Meniskus durch einen wenig belasteten Luftraum schafft die Entkopplung von Meniskenradien und Meniskendicke. Dadurch gelingt es, beide Linsen L24, L25 auf geringe Dicke zu setzen und die Gesamtdicke zu senken.

10 [0032] Die beiden negativen Menisken L29 und L30 mit der abschließenden Sammellinse L31 werden in der Literatur teilweise auch als sechste Linsengruppe bezeichnet.

[0033] Die Korrektur der sagittalen schiefen sphärischen Aberration bereitet bei Aperturerhöhung besondere Probleme. Durch die obengenannten Maßnahmen im Blendenbereich werden diese bereits gemildert, aber noch nicht gelöst. Im feldwirksamen Bereich zwischen Blende AS und Bild IM wird zur Korrektur der sagittalen schiefen sphärischen Aberration eine Erhöhung der Einzelbrechkraft von Plus- (L26, L27, L28, L31) und Minuslinsen (L29, L30) vorgesehen. Das Mittel der Wahl ist damit die Korrektur durch Kompensation der Bildfehler höherer Ordnung. Allerdings ist dies auch für die relativ großen Durchmesser der Linsen L19 bis L25 im Blendenraum verantwortlich. Die Brechkraft der Negativlinse L29 ist also hoch, drei vorangestellte Positivlinsen L26 bis L28 erlauben die verteilte Bereitstellung der entsprechenden positiven Brechkraft. Durch den bei drei Linsen großen Freiraum hinsichtlich der Durchbiegung der Linsen wird es möglich, die Sinus i-Winkel der Komastahlen hier jeweils unter dem Wert der hohen numerischen Apertur von 0,80 zu halten. Die starke Durchbiegung des negativen Meniskus L29 ergibt vor und hinter ihm sphärisch überkorrigierende Lufträume.

[0034] Die Korrektur der Bildfehler außerhalb der Hauptschnitte wird durch die gesteigerte Apertur ganz erheblich erschwert. Zu ihrer Korrektur wird die Abstimmung der Brechkraft in der dritten Linsengruppe LG3 im Bereich des zweiten Bauchs B2 optimiert. Das Linsenpaar L14 und L15 lenkt das Strahlbündel in die zweite Taille T2 und schafft damit in platzsparender Weise ebenso wie Linse L18 einen günstigen Beitrag zur Petzvalkorrektur. Die positiven Linsen L10 bis L13 der dritten Linsengruppe LG3 und die negative Linsengruppe LG4 werden dadurch von Brechkraft entlastet.

[0035] Die positive Brechkraft von L14 verbessert die Bildfehler betrachtet im 45°-Schnitt durch die Apertur. Durch die negative Brechkraft von L15 wird die negative vierte Linsengruppe LG4 mit den sphärisch überkorrigierenden Linsen L16 und L17 entlastet, wodurch Zonenfehler in Apertur und Feld reduziert werden.

[0036] Zwei Einzellinsen L14, L15 sind hier einem dicken Meniskus klar vorzuziehen: Zum einen kann wie dargestellt die Bildfehlerkorrektur substantiell verbessert werden, zum anderen wird die Kühlung der Linsen, was bei dem schlitzförmigen Feld von Scannern und der nicht vernachlässigbaren Absorption bei hoher Strahlungsleistung ein als „lens heating“ bekanntes Problem ist (besonders bei 193nm), verbessert.

Diese Merkmale sind auch bei den folgenden Ausführungsbeispielen entsprechend zu finden.

[0037] Die weiteren Ausführungsbeispiele Fig. 2 und 3 sowie 6 sind bei mäßig hoher Apertur NA = 0,7 ausgeführt. Die Schnittweiten reduzieren sich dabei auf 1000 mm. Das zweite Ausführungsbeispiel nach Figur 2 und Tabelle 2 zeigt, daß das Design gegenüber Änderungen in den ersten beiden Linsengruppen LG1 und LG2 weitgehend stabil ist. In der ersten Linsengruppe LG1 haben die ersten beiden Linsen 201 und 202 gegenüber Figur 1 einen Platzwechsel vorgenommen. In der zweiten Linsengruppe LG2 ist eine positive Linse 207 zwischen die negativen Linsen 206 und 208 bis 210 eingeschoben. Die Ausbildung dieser Linsengruppe LG2 mit oder ohne Positivlinse wird im Stand der Technik vielfach als wichtig dargestellt, so in EP 0 770 895-A (ohne) und EP 0 717 299-A (mit).

[0038] Insbesondere die fünfte Linsengruppe zeigt die gleichen qualitativen Merkmale, durch die reduzierte Apertur sind aber die Linsendurchmesser wesentlich reduziert.

[0039] Gegenüber dem Meniskuspaa L24/L25 ist hier bei den Linsen 225, 226 der dünne Luftspalt deutlich weniger gekrümmt. Der bei L24/L25 zu Figur 1 beschriebene Haupteffect der sphärischen Überkorrektur bleibt erhalten.

[0040] Das dritte Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und Tabelle 3 zeigt die erste Linsengruppe wie Beispiel 2. Die zweite Linsengruppe LG2 zeigt die Positivlinse 308 nunmehr in die Mitte zwischen die je zwei Negativlinsen 306, 307 und 309, 310 gewandert.

[0041] Die fünfte Linsengruppe LG5 ist jetzt durch Zusammenfassen der Linsen L24 und L25 der Figur 1 zum dicken Meniskus 325 um eine Linse auf 13 Linsen reduziert. Mit dieser Anordnung ist ebenso wie bei einer Aufteilung des Meniskus in die zwei Linsen L24 und L25 eine gleich gute Abbildungsleistung möglich.

[0042] Bei beiden Ausführungsbeispielen nach Figuren 2 und 3 ist außer der Abschluß-Planplatte P2 noch eine blendennahe Planplatte P1 vorgesehen. Diese kann z.B. als Apodisations-Filter genutzt werden.

[0043] Die erreichte gute Bildfehlerkorrektur soll für das Beispiel der Figur 1 näher dargestellt werden. Figuren 4a bis 4c zeigen die sagittale Querabweichung DZS als Funktion des halben Aperturwinkels DW' für die Bildhöhen 13,6, 9,6 und 0 mm. Figuren 5a bis 5c zeigen die entsprechenden Meridionalschnitte DYM.

[0044] In Tabelle 4 ist die Verzeichnung des Hauptstrahls Vhs für verschiedene Bildhöhen (in Bruchteilen der maximalen Bildhöhe $Y' = 13,6$ mm) angegeben. Sie liegt für alle Bildhöhen bei maximal 1,5 nm.

[0045] Tabelle 5 gibt die Abweichung der Verzeichnung ΔV von diesem Vhs für verschiedene Einstellungen der numerischen Apertur NA und des Kohärenzgrads Sigma. Ringaperturbeleuchtungen mit den Werten von 0,35-0,70 und 0,50-0,85 von Sigma sind ebenfalls berücksichtigt. Der Größtwert dieser Abweichung ist 4,7 nm, überwiegend liegen die Werte unter 3 nm.

[0046] Insgesamt liegt die Verzeichnung also überall und mit allen Einstellungen unter 10nm, sogar unter 6nm und überwiegend noch darunter. Dabei sind diese Werte im Zusammenhang mit der sehr hohen NA von 0,8 dieses Objektivs zu sehen. Bei kleinerer NA lassen sich erheblich kleinere Verzeichnungen realisieren..

[0047] Es zeigt sich also eine sehr gute Stabilität dieses Designs gegen Änderungen der ausgenutzten Apertur NA (abblenden) und Verändern des Beleuchtungs-Settings (Sigma).

[0048] Das weitere Ausführungsbeispiel nach Figur 6 und Tabelle 6 unterscheidet sich von den vorangehenden Beispielen hauptsächlich durch eine minimierte Variation der realen Blendenlage von 25 mm auf jetzt 15 mm. Dies wurde dadurch erreicht, daß das gekrümmte Bild (Blende) der Pupille durch gezielte Korrektur des Astigmatismus im Tangentialschnitt teilweise kompensiert wurde. Damit kann eine Abblendung ohne Lageänderung der Blende AS ausgeführt werden. Der Abbildungsmaßstab ist 1:4, die numerische Apertur ist $NA = 0,70$.

[0049] Insgesamt entspricht der Aufbau weitgehend dem Beispiel der Figur 1. Der Luftspalt zwischen den Linsen 624 und 625 ist nur wenig gekrümmt.

[0050] Figur 7 gibt einen Überblick über ein Beispiel einer Projektionsbelichtungsanlage mit erfindungsgemäßem Projektionsobjektiv. Ein geeignetes Beleuchtungssystem B ist beispielsweise aus EP 0 747 772-A (US Ser. No. 08/658,605) bekannt.

[0051] Der Laser 1 ist ein in der Mikrolithographie im tiefen Ultraviolett (DUV) gebräuchlicher KrF-Excimer-Laser mit 248nm Wellenlänge.

[0052] Ein Strahlaufweiter 14, z.B. eine Spiegelanordnung nach DE-A 41 24 311, dient zur Kohärenzreduktion und Vergrößerung des Strahlquerschnitts.

[0053] Ein erstes diffraktives optisches Rasterelement 9 bildet die Objektebene eines Objektivs 2, in dessen Austrittspupille ein zweites diffraktives optisches Rasterelement 8 vorgesehen ist.

[0054] Eine Einkoppeloptik 4 überträgt das Licht auf die Eintrittsfläche 5e eines Glasstabs 5, der durch mehrfache innere Reflexion das Licht mischt und homogenisiert. Unmittelbar an der Austrittsfläche 5a ist eine Zwischenfeldebene, in der ein Reticle-Masking-System (REMA) 51, eine verstellbare Feldblende, angeordnet ist. Das nachfolgende REMA-Objektiv 6, mit Linsengruppen 61, 63, 65, Umlenkspiegel 64 und Pupillenebene 62 bildet die Zwischenfeldebene des Reticle-Masking-Systems 51 auf das Reticle 7 ab.

[0055] Bei einem Wafer-Scanner wird auf dem Reticle 7 ein schmaler Streifen, ein Rechteck mit einem Aspektverhältnis von 1 : 2 bis 1 : 8, beleuchtet und durch Scannen das gesamte strukturierte Feld eines Chips seriell beleuchtet. Die Beleuchtung ist extrem gleichmäßig und randscharf (nur in Richtung senkrecht zur Scanrichtung) zu gestalten.

[0056] Die Ausführung der dem Glasstab 5 vorgelagerten Teile, insbesondere der optischen Rasterelemente 8 und 9, ist so gewählt, daß die Eintrittsöffnung 5e nicht nur möglichst homogen, sondern auch mit höchstmöglichem Wirkungsgrad, d.h. ohne wesentliche Lichtverluste neben der Eintrittsöffnung 5e, ausgeleuchtet wird.

[0057] Wie in DE 44 21 053 beschrieben, ist das Objektiv 2 ein Zoom-Objektiv (bewegliche Linse 22) mit integrierbarem verstellbarem Axicon-Paar 21. Die Brennweite hat einen dreifachen Dehnungsbereich, so daß partiell kohärente Beleuchtung mit üblichen Werten von $ca. 0,3 \leq \sigma \leq 0,9$ erzeugt werden kann.

[0058] Durch Verstellen des Axicon-Paars 21 lassen sich zudem angepaßte Ringaperturbeleuchtungen einstellen. Durch zusätzliche Blenden oder spezielle Pyramidenform des Axicon-Paars 21 lassen sich zudem Sonderformen der Beleuchtung erzeugen.

[0059] Zwischen Reticle (Maske) 7 und Wafer 9, jeweils mit Scan-Einrichtung 71, 91 und den bekannten Hilfseinrichtungen, ist das erfindungsgemäße Projektionsobjektiv P mit den Linsengruppen P1 bis P5 angeordnet.

Tabelle 1

5

	No.	r (mm)	d (mm)		H _{max} (mm)
10	0b		20,147		
	L1	-2471,057	13,126	Quarzglas	
		-247,584	7,640		
15	L2	-163,307	10,000	Quarzglas	
		327,943	7,757		
	L3	662,693	22,614	Quarzglas	
20		-209,088	,750		
	L4	350,222	21,378	Quarzglas	
		-416,285	,750		76,9
25	L5	265,534	26,426	Quarzglas	
		-413,278	,750		
	L6	197,069	10,000	Quarzglas	
30		111,439	26,308		
	L7	-583,382	10,000	Quarzglas	63,0
		166,249	24,524		
35	L8	-200,161	10,000	Quarzglas	
		362,426	28,860		
	L9	-126,683	12,696	Quarzglas	
40		-1228,324	16,242		
	L10	-227,900	23,521	Quarzglas	
		-170,208	,750		
45	L11	47071,771	38,438	Quarzglas	
		-233,889	,750		
	L12	987,385	38,363	Quarzglas	
		-316,598	,750		123,3
50	L13	332,464	39,596	Quarzglas	
		-738,425	1,005		

55

EP 1 006 389 A2

5	L14	270,193	25,935	Quarzglas	
		1414,789	2,982		
	L15	176,884	18,578	Quarzglas	
		131,204	47,520		
10	L16	-248,290	10,000	Quarzglas	
		146,085	49,811		76,5
	L17	-130,140	10,000	Quarzglas	
		1307,156	41,204		
15	L18	-132,994	35,292	Quarzglas	
		-167,225	,813		
	L19	-328,933	24,010	Quarzglas	
20		-237,606	,864		
	L20	17258,370	43,549	Quarzglas	
		-329,484	9,091		
25	L21	2237,627	40,932	Quarzglas	
		-473,604	10,000		
	AS		,750		153,1
30	L22	632,745	28,431	Quarzglas	154,9
		-3192,952	,750		
	L23	259,148	45,432	Quarzglas	
35		1097,996	57,012		
	L24	-268,055	24,571	Quarzglas	
		-312,384	,902		
40	L25	-334,579	23,847	Quarzglas	
		-288,740	,750		
	L26	226,326	28,117	Quarzglas	
		547,657	,750		
45	L27	122,960	34,861	Quarzglas	
		225,966	,750		
	L28	117,965	21,109	Quarzglas	
50		174,068	13,226		
	L29	348,448	10,000	Quarzglas	

55

EP 1 006 389 A2

		60,716	11,148		
5	L30	73,830	10,069	Quarzglas	
		55,083	,750		
	L31	49,652	24,194	Quarzglas	
10		358,744	4,390		
	P1	∞	2,492	Quarzglas	
		∞	13,082		
15	IM				13,6
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					

Tabelle 2

5

	No.	r (mm)	d (mm)	
10	0b		16,403	
	201	-135,127	8,261	Quarzglas
		444,747	6,467	
15	202	2236,824	25,206	Quarzglas
		-162,634	,750	
	203	614,107	18,869	Quarzglas
20		-359,473	,767	
	204	296,810	20,742	Quarzglas
		-800,016	,828	
25	205	273,478	21,990	Quarzglas
		-784,045	,753	
	206	158,758	15,580	Quarzglas
30		92,816	26,614	
	207	-5054,350	11,927	Quarzglas
		-272,904	2,399	
35	208	-324,986	6,943	Quarzglas
		136,767	20,167	
	209	-260,466	7,605	Quarzglas
40		192,638	30,771	
	210	-103,229	8,994	Quarzglas
		-2019,310	13,398	
45	211	-206,341	17,802	Quarzglas
		-138,999	,751	
	212	958,350	42,708	Quarzglas
		-166,018	,750	
50	213	407,944	29,112	Quarzglas
		-547,681	,750	

55

EP 1 006 389 A2

5	214	202,874	32,883	Quarzglas
		-2504,913	1,264	
10	215	211,073	13,084	Quarzglas
		294,918	1,324	
15	216	159,796	15,645	Quarzglas
		111,543	36,908	
20	217	-255,208	10,239	Quarzglas
		127,421	40,141	
25	218	-120,165	9,745	Quarzglas
		1795,197	27,676	
30	219	-127,485	34,689	Quarzglas
		-146,296	1,681	
35	220	-317,078	20,599	Quarzglas
		-245,933	,762	
40	221	3679,928	30,729	Quarzglas
		-292,519	,650	
45	P1	∞	5,009	Quarzglas
		∞	17,000	
50	AS		25,000	
	222	801,236	27,052	Quarzglas
55		-632,990	,750	
	223	551,359	25,021	Quarzglas
60		-1150,052	,751	
	224	194,154	32,180	Quarzglas
65		591,161	34,477	
	225	-287,051	10,385	Quarzglas
70		3278,663	2,220	
	226	3516,772	30,035	Quarzglas
75		-295,907	,763	
	227	262,200	19,612	Quarzglas
80		1177,101	,822	
	228	99,415	26,707	Quarzglas

EP 1 006 389 A2

		191,643	,753	
5	229	105,014	16,537	Quarzglas
		128,146	12,829	
10	230	391,872	7,165	Quarzglas
		55,094	10,778	
	231	78,459	12,612	Quarzglas
15		56,684	,777	
	232	46,211	22,360	Quarzglas
		632,773	2,119	
20	P2	∞	1,935	Quarzglas
		∞		
25	IM			
30				
35				
40				
45				
50				
55				

Tabelle 3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

No.	r (mm)	d (mm)	
0b		16,402	
301	-129,495	8,261	Quarzglas
	498,546	5,177	
302	2910,308	25,398	Quarzglas
	-156,581	,050	
303	634,336	18,854	Quarzglas
	-347,330	,301	
304	306,046	18,385	Quarzglas
	-737,998	,348	
305	271,858	21,701	Quarzglas
	-702,302	,776	
306	156,163	17,879	Quarzglas
	92,619	25,370	
307	-2510,654	8,958	Quarzglas
	139,288	19,325	
308	-302,813	11,398	Quarzglas
	-154,794	5,090	
309	-167,161	7,960	Quarzglas
	178,376	32,638	
310	-103,339	9,166	Quarzglas
	-1706,866	12,661	
311	-202,377	17,389	Quarzglas
	-140,454	,651	
312	987,948	43,015	Quarzglas
	-166,809	,650	
313	410,646	29,373	Quarzglas
	-550,047	,651	

EP 1 006 389 A2

	314	205,772	33,049	Quarzglas
		-2521,253	,6514	
5	315	213,410	13,198	Quarzglas
		290,632	2,731	
10	316	163,855	18,894	Quarzglas
		111,910	36,126	
	317	-254,971	9,329	Quarzglas
		125,915	38,073	
15	318	-120,961	9,708	Quarzglas
		1713,294	25,896	
	319	-128,631	34,802	Quarzglas
20		-148,294	2,087	
	320	-321,227	19,897	Quarzglas
		-242,281	,618	
25	321	2663,658	30,600	Quarzglas
		-296,524	,681	
	P1	∞	4,588	Quarzglas
30		∞	17,000	
	AS			
	322	799,643	27,212	Quarzglas
35		-634,102	,705	
	323	524,124	26,037	Quarzglas
		-1088,912	,650	
40	324	194,184	32,260	Quarzglas
		593,348	32,929	
	325	-291,552	42,741	Quarzglas
45		-300,355	,729	
	326	262,260	19,800	Quarzglas
		1149,322	,701	
	327	101,103	27,117	Quarzglas
50		197,398	,637	
	328	105,683	17,553	Quarzglas
55				

EP 1 006 389 A2

		131,192	11,164	
5	329	445,739	7,334	Quarzglas
		56,924	10,924	
	330	78,549	13,969	Quarzglas
10		56,171	1,161	
	331	46,702	22,163	Quarzglas
		689,875	2,680	
15	P2	∞	1,749	Quarzglas
		∞	11,991	
20	IM			

Tabelle 4

Vhs (nm)				
1/8	2/8	4/8	6/8	1
1,1	1,5	0,1	0,9	0,7

Tabelle 5

ΔV (nm)						
NA	Sigma	1/8	2/8	4/8	6/8	1
0,80	0,35	3,6	2,2	1,3	3,9	-1,2
0,80	0,50	3,3	2,2	1,3	3,2	-1,3
0,80	0,70	3,0	1,6	0,1	1,7	-1,4
45 0,80	0,90	2,5	0,7	-1,2	0,9	-0,7
0,80	0,35-0,70	2,7	1,4	-0,3	0,8	-1,5
0,80	0,50-0,85	2,2	0,3	-2,0	-0,2	-0,6
50 0,70	0,50	2,9	2,7	3,0	4,5	-1,8
0,70	0,70	2,6	2,1	1,7	2,7	-2,0
0,70	0,90	2,5	1,5	0,6	1,7	-1,5
0,70	0,35-0,70	2,6	2,0	1,4	2,0	-1,9
55 0,70	0,50-0,85	2,4	1,3	-0,1	0,6	-1,6
0,60	0,70	3,3	3,6	4,2	4,7	-1,2

EP 1 006 389 A2

Tabelle 5 (fortgesetzt)

ΔV (nm)						
NA	Sigma	1/8	2/8	4/8	6/8	1
0,60	0,90	3,0	2,9	2,8	3,1	-1,7
0,60	0,35-0,70	3,2	3,5	4,1	4,5	-1,3
0,60	0,50 - 0,85	2,8	2,7	2,5	2,5	-2,1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

No.	r (mm)	d (mm)	Glas
0b		36,005	
601	-1823,618	15,518	Quarzglas
	-214,169	10,000	
602	-134,291	7,959	Quarzglas
	328,009	6,376	
603	783,388	26,523	Quarzglas
	-163,805	,600	
604	325,109	20,797	Quarzglas
	-499,168	1,554	
605	224,560	24,840	Quarzglas
	-403,777	,600	
606	142,336	9,000	Quarzglas
	86,765	23,991	
607	6387,721	7,700	Quarzglas
	148,713	21,860	
608	-185,678	8,702	Quarzglas
	237,204	30,008	
609	-104,297	9,327	Quarzglas
	-1975,424	12,221	
610	-247,819	17,715	Quarzglas
	-152,409	,605	
611	1278,476	40,457	Quarzglas
	-163,350	,778	
612	697,475	28,012	Quarzglas
	-346,153	2,152	
613	232,015	28,068	Quarzglas
	-3080,194	2,606	

EP 1 006 389 A2

	614	219,153	21,134	Quarzglas
		434,184	9,007	
5	615	155,091	13,742	Quarzglas
		103,553	34,406	
	616	-207,801	8,900	Quarzglas
10		131,833	35,789	
	617	-118,245	9,299	Quarzglas
		1262,191	27,280	
15	618	-121,674	42,860	Quarzglas
		-151,749	,825	
	619	-366,282	20,128	Quarzglas
20		-236,249	,838	
	620	2355,228	31,331	Quarzglas
		-296,219	2,500	
25	P61	∞	6,000	Quarzglas
		∞	12,554	
	AS			
30	621	774,283	29,041	Quarzglas
		-782,899	,671	
	622	456,969	28,257	Quarzglas
35		-1483,609	,603	
	623	227,145	30,951	Quarzglas
		658,547	36,122	
40	624	-271,535	15,659	Quarzglas
		-997,381	4,388	
	625	-1479,857	27,590	Quarzglas
45		-288,684	,604	
	626	259,988	22,958	Quarzglas
		1614,379	,600	
50	627	105,026	29,360	Quarzglas
		205,658	,600	
	628	110,916	16,573	Quarzglas
55				

		139,712	13,012	
5	629	499,538	8,300	Quarzglas
		56,675	9,260	
	630	75,908	17,815	Quarzglas
10		51,831	,995	
	631	43,727	19,096	Quarzglas
		499,293	2,954	
15	P62	∞	2,000	Quarzglas
		∞	12,000	
20	Im			

Patentansprüche

1. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenordnung, bestehend aus

einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft, zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft, dritten Linsengruppe (LG3) positiver Brechkraft, vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft und fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft dadurch gekennzeichnet, daß die bildseitige numerische Apertur größer als 0,65 ist, vorzugsweise größer als 0,68, die Systemblende (AS) in der fünften Linsengruppe (LG5) liegt und mindestens zwei Linsen dieser Linsengruppe (LG5) vor der Systemblende (AS) liegen.

2. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenordnung, bestehend aus einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft, zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft, dritten Linsengruppe (LG3) positiver Brechkraft, vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft und fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende in der fünften Linsengruppe (LG5) liegt, mindestens zwei Linsen (L18, L19, L20, L21) dieser Linsengruppe (LG5) vor der Systemblende (AS) liegen und diese Linsengruppe (LG5) mindestens 13 Linsen (L18 - L31) aufweist.

3. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende (AS) zwischen zwei Sammellinsen (L21, L22) angeordnet ist und bildseitig mindestens eine weitere Sammellinse (L23) unmittelbar folgt.

4. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Linse (L18) der fünften Linsengruppe (LG5) ein schwach brechender dicker objektseitig konkaver Meniskus ist.

5. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Systemblende (AS) genau eine objektseitig konkave Linse (225, 325) folgt.

6. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die objektseitig konkave

Linse (325) ein dicker Meniskus ist.

7. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die objektseitig konkave Linse (225) mit einem dünnen Luftspalt von einer Sammellinse (226) gefolgt wird.
8. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Systemblende (AS) genau ein Paar objektseitig konkaver Linsen (L24, L26) folgt, welche mit einem dünnen Luftspalt voneinander getrennt sind.
9. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Luftspalt objektseitig konkav ist. (Fig. 6)
10. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß beim Abblenden bis zu 70 % der numerischen Apertur die Verzeichnung unterhalb von 10 nm, vorzugsweise unter 6 nm, bleibt.
11. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenanordnung, bestehend aus
 - einer ersten Linsengruppe (LG1) mit positiver Brechkraft, einen Bauch (B1) des Lichtbündels bildend,
 - einer zweiten Linsengruppe (LG2) mit negativer Brechkraft, eine Taille (T1) des Lichtbündels bildend,
 - einer dritten Linsengruppe (LG3) mit positiver Brechkraft, einen zweiten Bauch (B2) des Lichtbündels bildend,
 - einer vierten Linsengruppe mit negativer Brechkraft, eine zweite Taille (T2) des Lichtbündels bildend,
 - einer fünften Linsengruppe (LG5) mit positiver Brechkraft, einen dritten Bauch (B3) des Lichtbündels bildend,
 - dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende (AS) in der fünften Linsengruppe (LG5) angeordnet ist, und zwar im Bereich der Linse (L22), an der das Lichtbündel den größten Durchmesser annimmt, und ihrer beiden benachbarten Linsen (L21, L23).
12. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende (AS) zwischen zwei Sammellinsen (L21, L22) der fünften Linsengruppe (LG5) angeordnet ist.
13. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Linsengruppe (LG2) mindestens zwei negative Linsen (206, 208-210) und eine positive Linse (207) enthält.
14. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-13, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Linse (201) objektseitig konkav ist.
15. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-14, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich der vierten Linsengruppe (LG4) genau drei Negativ-Linsen (L15-L17) rund um die zweite Taille (T2) angeordnet sind.
16. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-15, dadurch gekennzeichnet, daß der Sinus des i-Winkels des Randstrahls ($\sin i_{\text{Rand}}$) an allen Linsen vor der letzten objektseitigen Linse (L31) Meiner als die objektseitige numerische Apertur (NA) ist ($\sin i_{\text{Rand}} < \text{NA}$).
17. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit
 - einer Lichtquelle (1), insbesondere einem DUV-Excimer-Laser,
 - einem Beleuchtungssystem (B),
 - einem Masken-Halte- und -Justiersystem (7, 71)
 - einem Projektionsobjektiv (P) nach mindestens einem der Ansprüche 1-16 und
 - einem Objekt-Halte- und -Justier-System (9, 91).

EP 1 006 389 A2

18. Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Beleuchtungssystem (B) verschiedene Beleuchtungsarten, insbesondere mit verschiedenem Kohärenzgrad, erzeugt und das Projektionsobjektiv (P) bei den verschiedenen Beleuchtungsarten die Verzeichnung unterhalb von 10nm, vorzugsweise unterhalb von 6nm hält.

5

19. Herstellverfahren mikrostrukturierter Bauelemente unter Anwendung mehrerer mikrolithographischer Belichtungen mit einer Projektionsbelichtungsanlage mit den Merkmalen der Ansprüche 17 und 9, wobei bei verschiedenen Belichtungen verschiedene Beleuchtungsarten und/oder numerische Apertur eingestellt werden.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG. 1

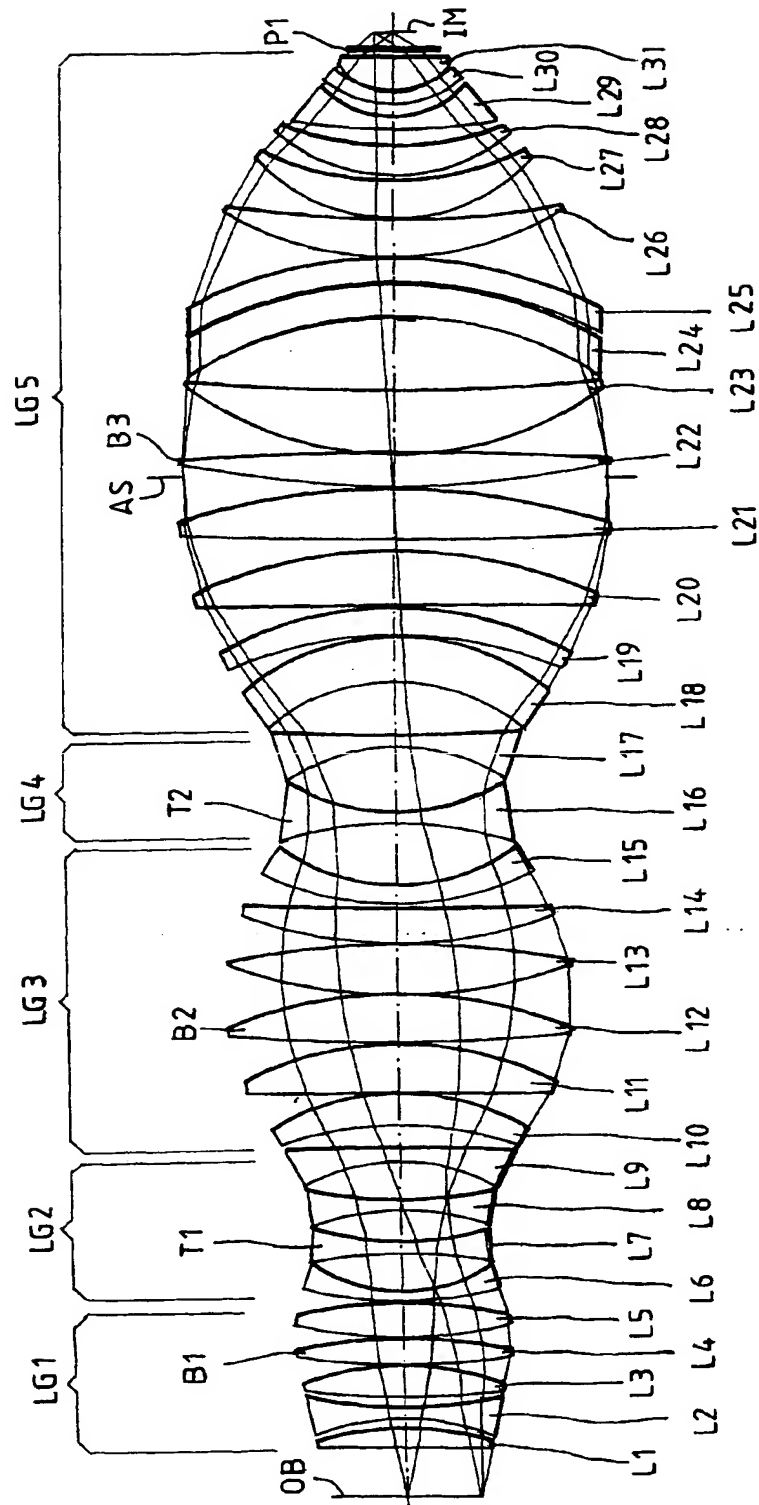


FIG. 2

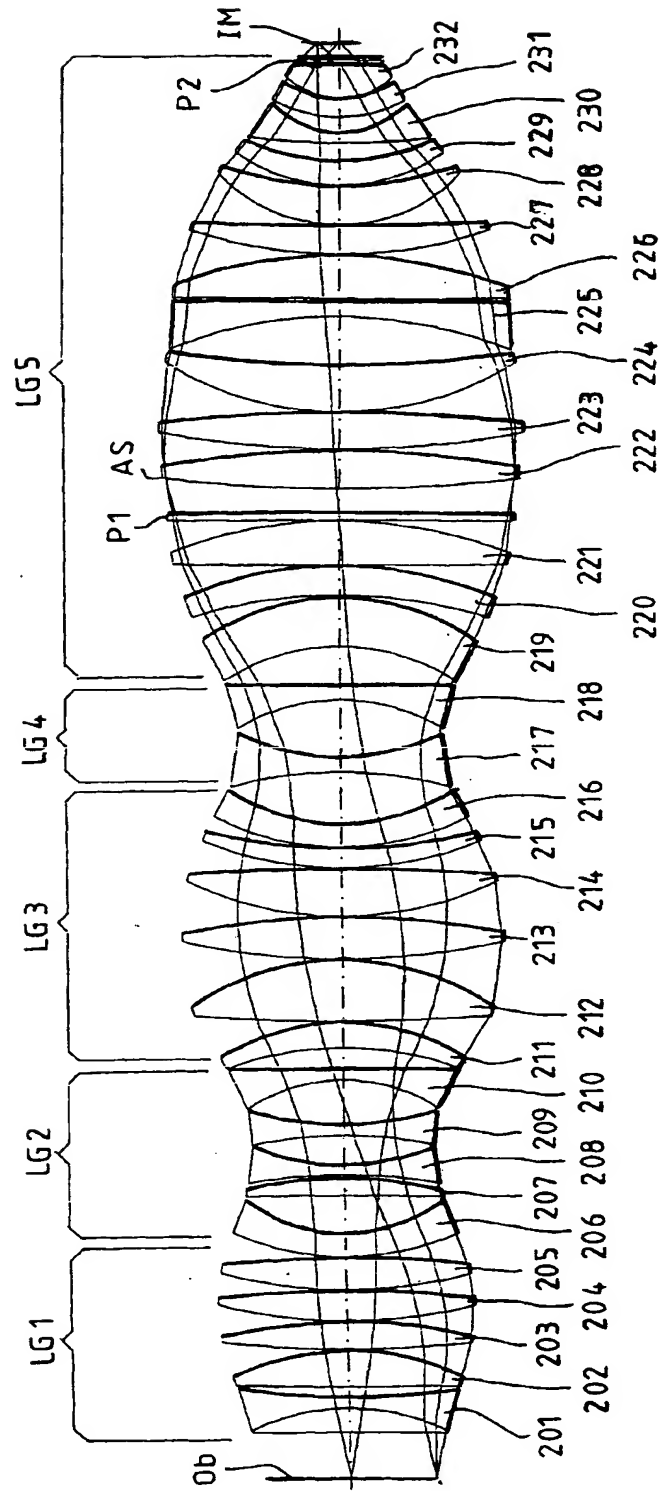


FIG. 3

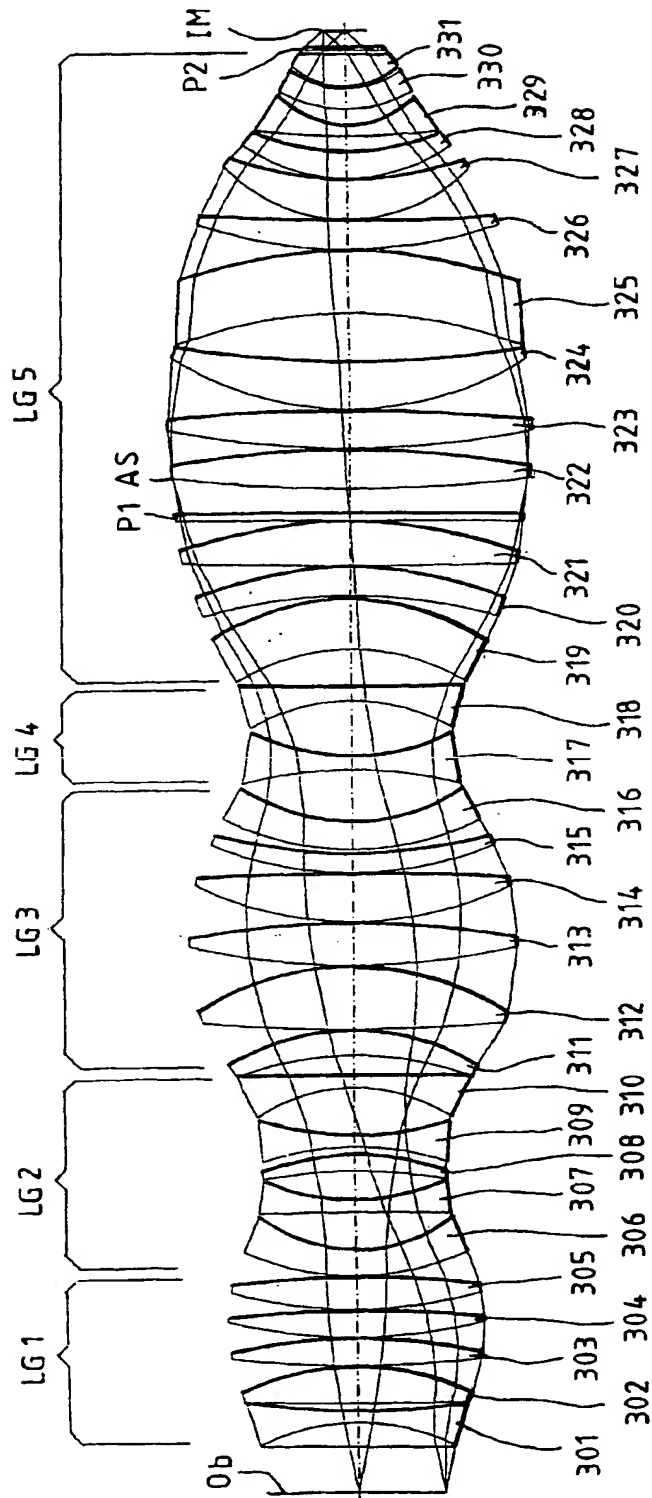


FIG. 4a

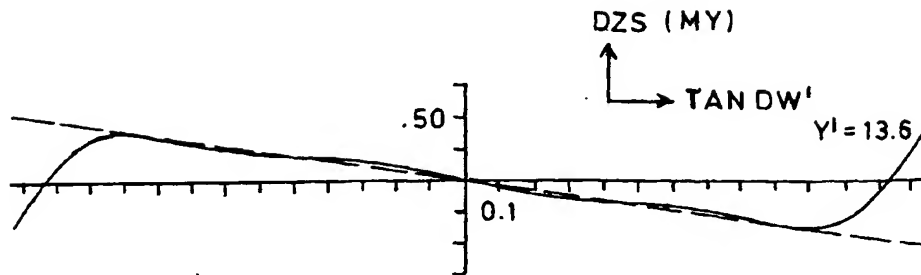


FIG. 4b

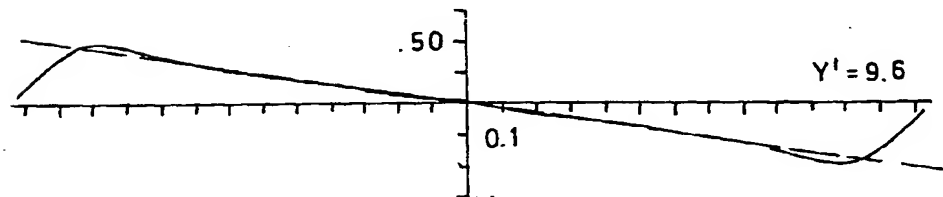


FIG. 4c

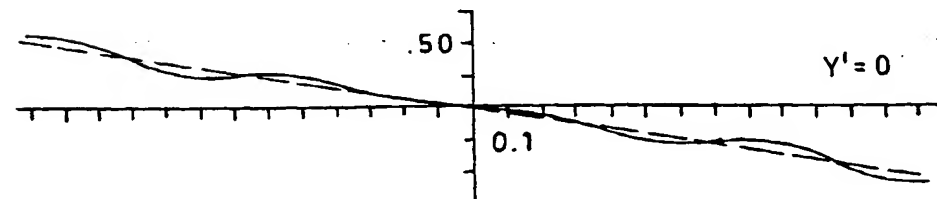


FIG. 5a

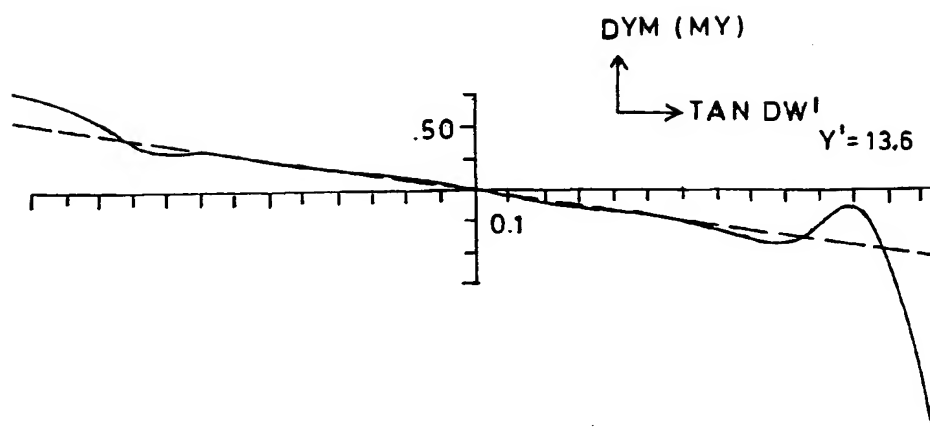


FIG. 5b

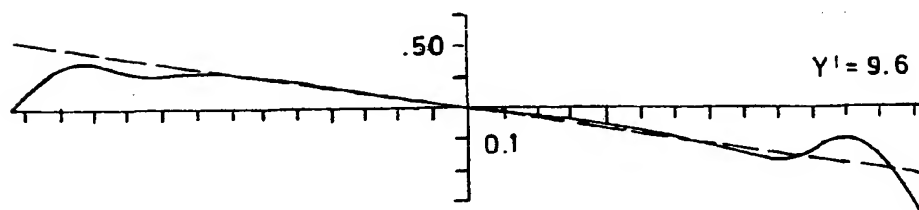


FIG. 5c

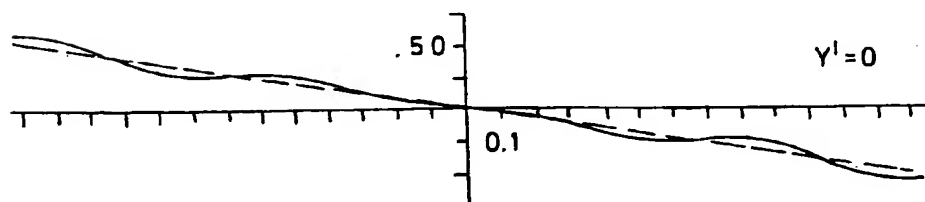
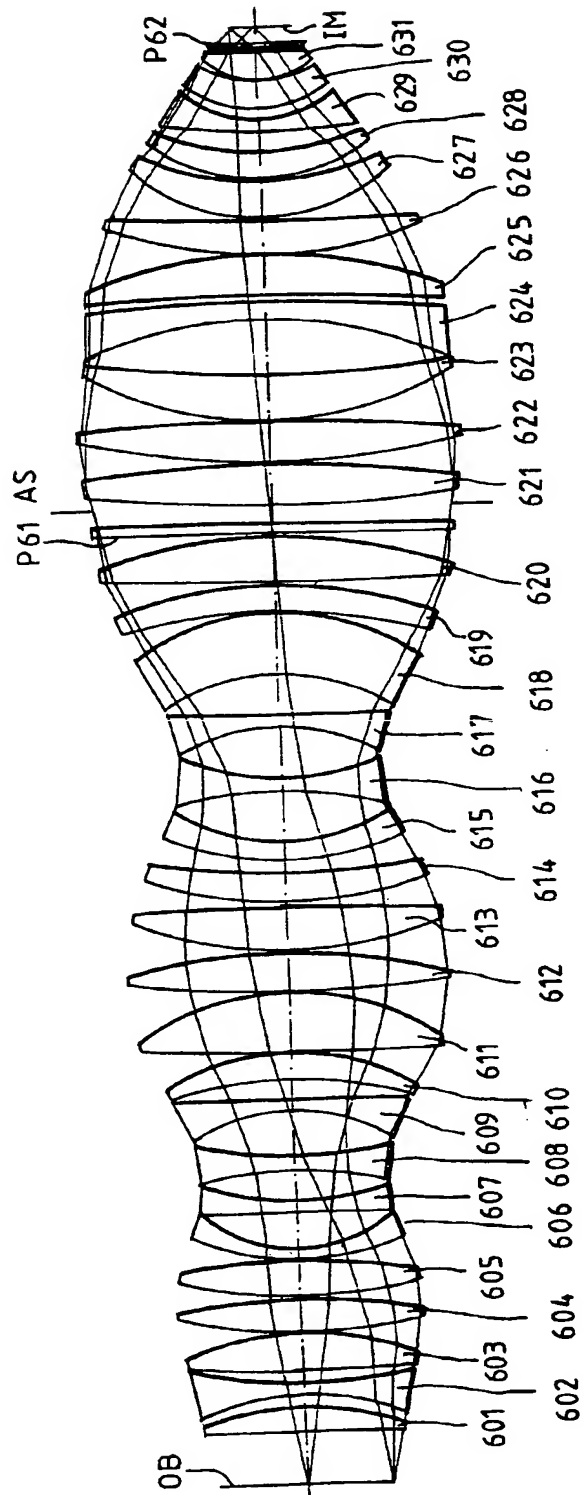


FIG. 6



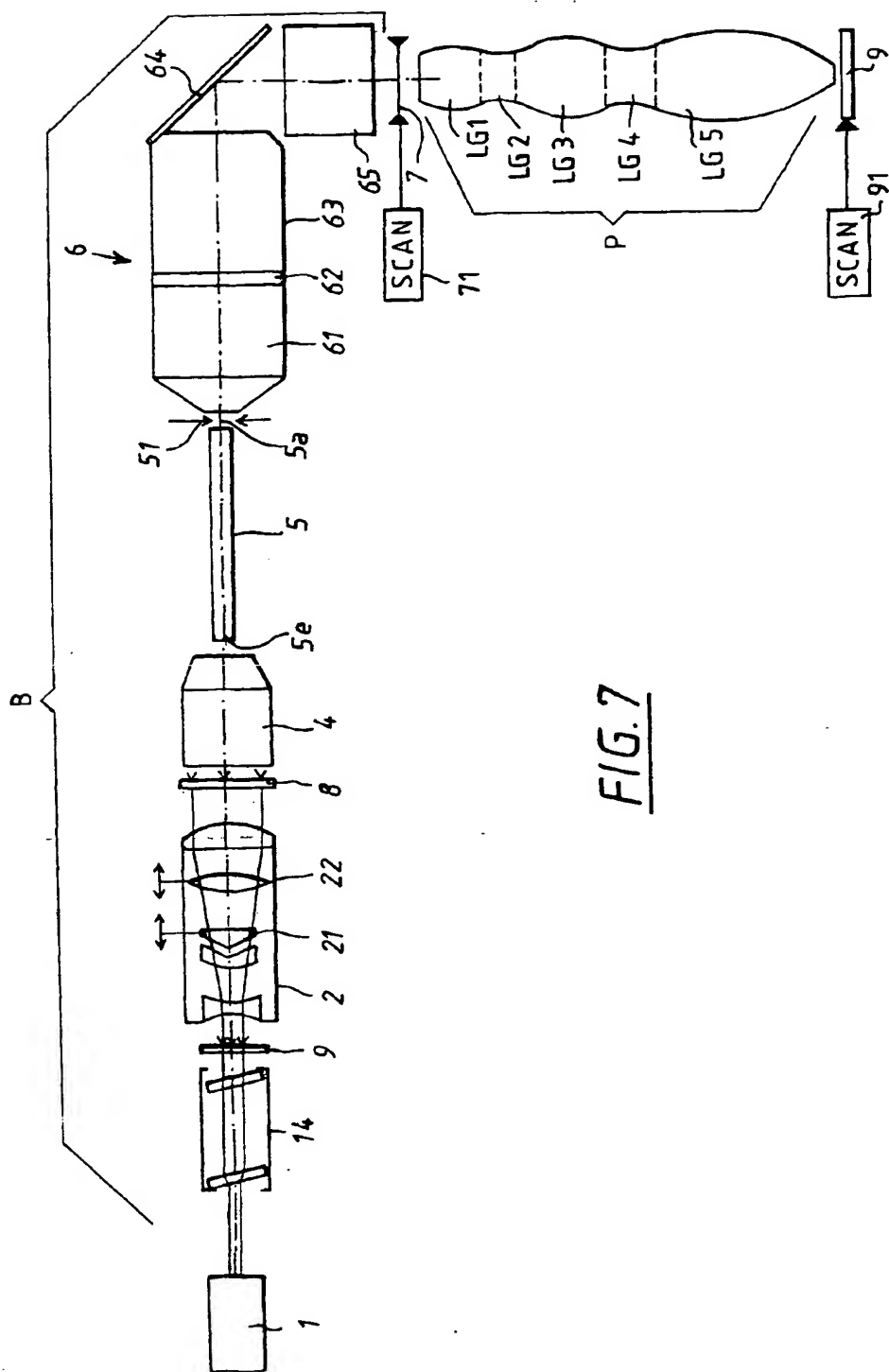


FIG. 7